

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 3 部門第 4 区分  
 【発行日】平成 24 年 9 月 27 日 (2012.9.27)

【公表番号】特表 2010-514940 (P2010-514940A)  
 【公表日】平成 22 年 5 月 6 日 (2010.5.6)  
 【年通号数】公開・登録公報 2010-018  
 【出願番号】特願 2009-544347 (P2009-544347)  
 【国際特許分類】

C 2 3 C 14/34 (2006.01)

【F I】

C 2 3 C 14/34 S

C 2 3 C 14/34 P

【手続補正書】

【提出日】平成 24 年 8 月 13 日 (2012.8.13)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

陰極スパッタリングにより基板 (3) の平坦な基板表面 (4) 上に基板表面 (4) における一定の公称の方向性で方向性を有する層を形成するための装置であって、少なくとも 1 つのターゲット (5) が置かれた真空チャンバ (10) を有し、前記基板表面 (4) が前記少なくとも 1 つのターゲット (5) のターゲット表面 (6) に向かい合うような形で前記基板 (3) を取り付けに適した少なくとも 1 つのホルダを含み、実質的に平坦で互いに平行な複数のプレート (9) を有する少なくとも 1 つのコリメータ (8) が前記ターゲット表面 (6) とホルダの間に置かれた装置において、

前記プレート (9) は前記基板表面 (4) に垂直な方向に整列され、プレート (9) の平均の長さは前記コリメータ (8) の中心から外側端部へ向かうにつれて減少することを特徴とする装置。

【請求項 2】

前記プレート (9) の少なくとも一部の厚さは基板表面 (4) に平行な方向において変化する請求項 1 記載の装置。

【請求項 3】

前記厚さはいずれも前記プレート (9) の中心点から外側端部へ向かうにつれて減少する請求項 2 記載の装置。

【請求項 4】

前記ホルダに対する前記コリメータ (8) の位置は、一方の位置において各プレート (9) が他方の位置においては空き状態である地点を互いに占めるような形で 2 つの地点間で切り換わり得る請求項 1 ~ 3 のいずれか 1 項に記載の装置。

【請求項 5】

前記コリメータ (8) の一方の位置において端のプレートは例外として各プレートはいずれも他方の位置においては他のプレート (9) によって占められる 2 つの位置の中間にほぼ位置する場所を互いに占める請求項 4 記載の装置。

【請求項 6】

前記コリメータ (8) は、前記基板表面 (4) に対してそれへ向かう軸の回りに半回転することでそれぞれの他の位置へ移動し得る請求項 4 または 5 記載の装置。

**【請求項 7】**

前記プレート（ 9 ）の平均の厚さは前記コリメータ（ 8 ）の中心から外側端部へ向かうにつれて減少する請求項 1 ～ 6 のいずれか 1 項に記載の装置。

**【請求項 8】**

前記ホルダは前記ターゲット表面（ 6 ）に対して前記複数のプレート（ 9 ）に平行な方向に移動し得る請求項 1 ～ 7 のいずれか 1 項に記載の装置。

**【請求項 9】**

好ましい磁化方向を有する磁気層の製造のために請求項 1 ～ 8 のいずれか 1 項に記載の装置を使用する方法。